## 本 国 特 許 庁 PCT/JP 2 JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP 2004/004643

31. 3. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

H

2003年 6月27日

出願番号 Application Number:

特願2003-183968

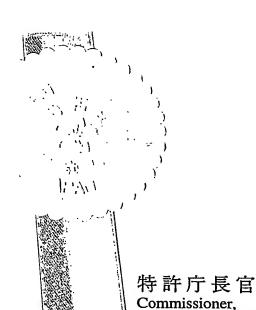
[ST. 10/C]:

[JP2003-183968]

出 願 人 Applicant(s):

石川島播磨重工業株式会社

RECEIVED
2 7 MAY 2004
WIPO PCT



Japan Patent Office

# DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

PRIORITY

2004年 5月14日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

P6872

【提出日】

平成15年 6月27日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B27B 15/00

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市磯子区新中原町1番地 石川島播磨重工

業株式会社 横浜第2工場内

【氏名】

勝俣 和彦

【特許出願人】

【識別番号】

000000099

【氏名又は名称】

石川島播磨重工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100097515

【住所又は居所】

東京都港区芝5丁目26番20号 建築会館4階 アサ

国際特許事務所

【弁理士】

【氏名又は名称】

堀田 実

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

027018

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

0113415

【プルーフの要否】

要



【発明の名称】 真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理品を静置する冷却領域を囲む冷却室と、該冷却室内を通過するガスを冷却して循環させるガス冷却循環装置とを備え、加熱した被処理品を加圧した循環ガスで冷却する真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置であって、

冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固定仕切板と、該固定仕切板の表面 に沿って回転駆動される回転仕切板とを有し、

固定仕切板はほぼ全面を貫通する開口を有し、回転仕切板は、ガス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する吸引開口と吐出開口を有し、これにより冷却室内を通過するガスの方向を交互に切り替える、ことを特徴とする真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置。

【請求項2】 前記冷却室は、その内側を上下方向に通過するガス流路を有し、

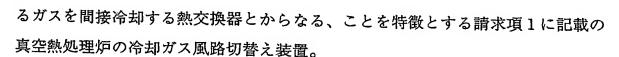
冷却室内をガスが下方に流れるときに、吸引開口が冷却室の下方のみと連通しかつ吐出開口が冷却室の上方のみと連通し、

冷却室内をガスが上方に流れるときに、吸引開口が冷却室の上方のみと連通しかつ吐出開口が冷却室の下方のみと連通するように開口位置が設定されている、ことを特徴とする請求項1に記載の真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置。

【請求項3】 前記冷却室内をガスが上下方向に流れるときに、吸引開口が 冷却室の下方のみ又は上方のみと選択的に連通しかつ吐出開口が冷却室の上方の み又は下方のみと選択的に連通し、

前記冷却室内をガスが水平方向に流れるときに、吸引開口が冷却室のいずれかの片側のみに選択的に連通しかつ吐出開口が冷却室の反対の片側のみと選択的に 連通するように開口位置が設定されている、ことを特徴とする請求項1に記載の 真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置。

【請求項4】 前記ガス冷却循環装置は、冷却室に隣接して設置され冷却室を通過したガスを吸引して加圧する冷却ファンと、該冷却ファンから吐出され



#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置に関する。

#### [0002]

## 【従来の技術】

真空熱処理炉は、内部を減圧した後、不活性ガス等を再充填して被処理品を熱処理する熱処理炉である。真空熱処理炉は、加熱後に炉内及び処理品についた水分等がガス化した後に再度減圧し、不活性ガス等を再充填することで、水分を完全に除去できるため、水分による色付きのない熱処理(「光輝熱処理」と呼ぶ)ができる利点がある。

## [0003]

また、ガス冷却式真空熱処理炉は、光輝熱処理ができ、かつ脱炭浸炭がない、変形が少ない、作業環境が良いなど、種々の利点を有する。しかし、初期のガス冷却式真空熱処理炉は、減圧冷却式であるため、冷却速度が不十分な欠点があった。そこで、冷却速度を高めるために、高速循環ガス冷却方式が実用化されている。

## [0004]

図7は、非特許文献1に開示された高速循環ガス冷却炉の構成図である。この図において、50は断熱材、51はヒータ、52は有効作業域、53は炉体及び水冷ジャケット、54は熱交換器、55はターボファン、56はファン用モータ、57は冷却扉、58は炉床、59はガスディストリビュータ、60は冷却ガスの風路を切替えるダンパーである。

## [0005]

また、特許文献1の「真空炉におけるガス循環冷却促進法」は、図8に示すように、気密性の真空容器61内に断熱壁67によって囲った加熱室66を設け、加熱室内に配置されたヒータ62により被熱物64を真空中で加熱すると共に、



真空容器 6 1 内にクーラ 6 2 およびファン 6 3 が設けられ真空容器内に供給された無酸化性ガスをクーラ 6 2 により冷却し、無酸化性ガスをファン 6 3 の回転により加熱室 6 6 の相対する断熱壁 6 7 面に設けられた開口 6 8 , 6 9 より加熱室 6 6 内に循環させて被熱物 6 4 を強制ガス循環冷却する真空炉において、少なくとも一端が末広がり状に形成れた耐熱性の筒状フード 6 5 を加熱室 6 6 内に置かれた被熱物 6 4 の周囲を適宜間隔を離して囲うように、かつその両端が前記開口 6 8 , 6 9 に相対するように配置して無酸化性ガスを加熱室 6 6 内に循環させるようにしたものである。なお、この図において 7 0 は冷却ガスの風路を切替えるダンパーである。

#### [0006]

#### 【非特許文献1】

山崎勝弘,金属材料の真空熱処理(2),熱処理30巻2号,平成2年4月 【特許文献1】

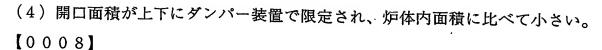
特開平5-230528号公報

#### [0007]

## 【発明が解決しようとする課題】

上述した非特許文献1及び特許文献1に記載の高速循環ガス冷却炉において、 上向きと下向きの風路を切り替える機構として上下にダンパー装置が通常用いら れている。しかし、上下のダンパー装置を風路切替え機構とした場合、以下の問 題点があった。

- (1) ダンパー装置は、その開閉位置により高速で通過する風圧による負荷変動が大きい。そのため、高圧ガスの場合にダンパー方式では風圧の影響でスムースに動かすことが困難である。
- (2) ダンパー装置は、開閉角度と開口面積が比例しない。そのため、上下の複数の駆動装置を切り替える際に、開口面積のバランスを整えることが難しく、吸込口及び吐出口の開口面積に差が生じたり、その変動が大きくなり、冷却ガス量が変動し、安定したガス冷却が困難である。
- (3)上下に複数のダンパー装置が存在し、複数の駆動装置が必要であり、構造が複雑となる。



本発明は、上述した問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の目的は、風圧の影響を受けにくくスムースに風路を切替えることができ、開口面積の変動や吸込口と吐出口の開口面積差が生じにくく、安定したガス冷却が可能であり、構造が簡潔であり単一の駆動装置で切替えが可能であり、大きな開口面積を確保できる真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置を提供することにある。

#### [0009]

## 【課題を解決するための手段】

本発明によれば、被処理品を静置する冷却領域を囲む冷却室と、該冷却室内を通過するガスを冷却して循環させるガス冷却循環装置とを備え、加熱した被処理品を加圧した循環ガスで冷却する真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置であって、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固定仕切板と、該固定仕切板の表面に沿って回転駆動される回転仕切板とを有し、固定仕切板はほぼ全面を貫通する開口を有し、回転仕切板は、ガス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する吸引開口と吐出開口を有し、これにより冷却室内を通過するガスの方向を交互に切り替える、ことを特徴とする真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置が提供される。

## [0010]

上記本発明の構成によれば、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固定仕切板の表面に沿って回転仕切板を回転駆動するだけで、冷却室内を通過するガスの方向を交互に切り替えるので、流れ方向に対して回転仕切板が垂直に動く回転駆動であるため、高圧ガス(密度が高いガス体)であっても風圧の影響を受けにくくスムースに風路を切替えることができる。

また、回転仕切板が、ガス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する吸引開口と吐出開口を有するので、開口面積の変動や吸込口と吐出口の開口面積差が生じにくく、安定したガス冷却が可能である。また、構造が簡潔であり単一の駆動装置で切替えが可能であり、大きな開口面積を確保できる。



本発明の好ましい第1実施形態によれば、前記冷却室は、その内側を上下方向に通過するガス流路を有し、冷却室内をガスが下方に流れるときに、吸引開口が冷却室の下方のみと連通しかつ吐出開口が冷却室の上方のみと連通し、冷却室内をガスが上方に流れるときに、吸引開口が冷却室の上方のみと連通しかつ吐出開口が冷却室の下方のみと連通するように開口位置が設定されている。

#### [0012]

この構成により、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る炉体内面積Aのうち、1/2づつをガス冷却循環装置の吸込口と吐出口とし、更に吸込口と吐出口のうち、1/2づつを下方、上方とすることで、吸引開口と吐出開口を炉体内面積Aの約1/4づつに設定することができる。従って、従来に比較して風路面積を大きくとれ、ガスの通過流速を低減でき、圧損を小さくできる。

また、固定仕切板とガス冷却循環装置の間は、内側全面がガス冷却循環装置の吸込口に連通し、外側全面だガス冷却循環装置の吐出口に連通しているので、吐出口/吸込み口の隙間を十分取ることで半面しか開口していなくても反対面への回り込みが可能となり、熱交換器全体を有効利用できる。

## [0013]

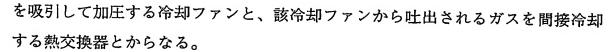
本発明の好ましい第2実施形態によれば、前記冷却室内をガスが上下方向に流れるときに、吸引開口が冷却室の下方のみ又は上方のみと選択的に連通しかつ吐出開口が冷却室の上方のみ又は下方のみと選択的に連通し、前記冷却室内をガスが水平方向に流れるときに、吸引開口が冷却室のいずれかの片側のみに選択的に連通しかつ吐出開口が冷却室の反対の片側のみと選択的に連通するように開口位置が設定されている。

## [0014]

この構成により、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固定仕切板の表面 に沿って回転仕切板を回転駆動するだけで、冷却室内を通過するガスの方向を上 下方向及び左右方向に自由に切り替えることができる。

## [0015]

前記ガス冷却循環装置は、冷却室に隣接して設置され冷却室を通過したガス



#### [0016]

この構成により、固定仕切板とガス冷却循環装置の間は、内側全面がガス冷却循環装置の吸込口に連通し、外側全面だガス冷却循環装置の吐出口に連通しているので、吐出口/吸込み口の隙間を十分取ることで半面しか開口していなくても 反対面への回り込みが可能となり、熱交換器全体を有効利用できる。

#### [0017]

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の好ましい実施形態を図面を参照して説明する。なお、各図において、共通する部分には同一の符号を付し、重複した説明を省略する。

#### [0018]

図1は、本発明の第1実施形態の冷却ガス風路切替え装置を備えた真空熱処理 炉の全体構成図である。この図において、この真空熱処理炉は、真空加熱炉10 、ガス冷却炉20、及び移動装置30を備えた多室型熱処理炉である。

真空加熱炉10は、被処理品1を減圧下で加熱する機能を有する。ガス冷却炉20は、加熱した被処理品1を加圧した循環ガス2で冷却する機能を有する。移動装置30は、被処理品1を真空加熱炉10とガス冷却炉20との間で移動する機能を有する。

## [0019]

真空加熱炉10は、内部が真空排気されるようになった真空容器11、被処理品1を内部に収容する加熱室12、加熱室に被処理品1を出し入れするための前扉13、加熱室内の被処理品1を移動させるための開口を閉じる後扉14、被処理品1を前後に水平移動可能に載せる載置台15、被処理品1を加熱するためのヒータ16、等からなる。この構成により、真空容器11の内部を真空に減圧し、ヒータ16により被処理品1を所定の温度まで加熱することができる。

## [0020]

移動装置30は、被処理品1を真空加熱炉10とガス冷却炉20との間で水平 に移動させる搬送棒32、後扉14を昇降させて開閉する後扉昇降装置33、前



扉13を昇降させて開閉する前扉昇降装置34、及びガス冷却炉20の中間断熱 扉21aを昇降させて開閉する中間扉昇降装置34を備える。この例において、 搬送棒32はラックピニオン駆動、後扉昇降装置33は直動シリンダ、前扉昇降 装置34と中間扉昇降装置34は巻上げ機であるが、本発明はこれに限定されず 、その他の駆動機構であってもよい。この構成により、後扉14、前扉13及び 中間断熱扉21aを開放した状態で、搬送棒32により、被処理品1を真空加熱 炉10とガス冷却炉20との間で水平に移動させることができる。

#### [0021]

図2は図1の部分拡大図であり、図3は図2のA-A線における断面図である。図1~図3に示すように、ガス冷却炉20は、真空容器21、冷却室22、ガス冷却循環装置24、冷却ガス風路切替え装置40及び整流器28を備える。

真空容器21は、真空加熱炉10の前扉13に対向して設けられた中間断熱扉21a、被処理品1を内部に収容する円筒形の容器胴部21b、ガス冷却循環装置24を収容する循環部21c、気密に開閉可能なクラッチリング21e、及びクランプ21dからなる。この構成により、クラッチリング21eを開放し循環部21cを容器胴部21bから図1で右方に後退させることにより、被処理品1を容器胴部21bの内部に直接収納することができる。また、クラッチリング21e、クランプ21dにより中間断熱扉21aと循環部21cを容器胴部21bに気密に連結し、加圧した冷却用ガス(アルゴン、ヘリウム、窒素等)を内部に供給することにより、加圧ガスを冷却に用いることができる。

#### [0022]

冷却室22は、真空加熱炉10に隣接して容器胴部21bの中央部に設けられる。冷却室22の真空加熱炉側は中間断熱扉21a、ガス冷却循環装置と両側面は気密性のある断熱壁22a、22bで仕切られている。またこの冷却室22は、上下端は開口しており、かつその内側に上下方向に断面一定のガス流路を形成している。この冷却室22の内側が冷却領域であり、被処理品1は、例えばジェットエンジンの動翼、静翼、ボルト等の小型金属部品であり、トレーやバスケット内に収容し、冷却室22の中央に通気性のある載置台23に載せて静置される



載置台23は真空加熱炉10の載置台15と同一高さに設置され、内蔵するローラ上を自由に移動できるようになっている。また、容器胴部21bと断熱壁22bの間に、図3に示すように水平仕切板22cが設けられ、冷却室22の上下に位置するガスを気密に仕切っている。

#### [0023]

ガス冷却循環装置 2 4 は、冷却室 2 2 に隣接して設置され冷却室 2 2 を通過したガスを吸引して加圧する冷却ファン 2 4 a と、該冷却ファンから吐出されるガスを間接冷却する熱交換器 2 5 とからなる。冷却ファン 2 4 a は、真空容器 2 1 の循環部 2 1 c に取付けられた冷却ファンモータ 2 4 b により回転駆動され、その中央部からガスを吸引し、外周部から吐出する。熱交換器 2 5 は、例えば内部を水冷された冷却フィンチューブである。 この構成により、外周部から吐出した循環ガスを熱交換器 2 5 で冷却し、冷却室 2 2 内を上下方向に通過するガスを冷却して循環することができる。

#### [0024]

整流器28は、冷却室22の上端及び下端を塞いで上下に設けられ、冷却室2 2を通過するガスの速度分布を均一化させる機能を有する。

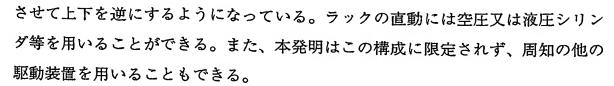
#### [0025]

また、本発明の高速循環ガス冷却式真空熱処理炉は、冷却室22の上下に冷却室から流出入するガス流の方向を案内する補助分配機構29 (例えば吹き込み板)を設け、冷却室の上下面積が大きい場合でも、複数箇所に向かうガス流の方向を最適化し、流れの均一化を高めるようになっている。

#### [0026]

図4は図2のB部拡大図である。この図に示すように、本発明の冷却ガス風路 切替え装置40は、固定仕切板42、回転仕切板44及び回転駆動装置46から なる。

固定仕切板42は、冷却室22とガス冷却循環装置24との間を仕切り、その間を遮断している。回転仕切板44は、固定仕切板42の表面に沿ってこの例では冷却ファン24aと同軸に回転駆動装置46により回転駆動される。回転駆動装置46はこの例では、ラックとピニオンであり、回転仕切板44を1/2回転



#### [0027]

固定仕切板 4 2 の中央部には軸受 4 3 a を内蔵する軸受箱 4 3 が設けらる。この軸受箱 4 3 は、支持フレーム 4 3 b により、真空容器 2 1 の循環部 2 1 c から支持されている。 回転仕切板 4 4 は、中心に回転軸 4 5 がキーを回転固定されており、この回転軸 4 5 は軸受 4 3 a により冷却ファン 2 4 a と同軸に支持れている。圧縮バネ 4 7 が、回転軸 4 5 の軸端部(図で左端と支持板 4 5 a)と回転仕切板 4 4 の間に圧縮状態で挟持され、回転仕切板 4 4 を常に回転仕切板 4 4 に向けて付勢し、その間の隙間を低減するようになっている。このため、付加すれば機能が向上する。

前述の水平仕切板22cの端面と固定仕切板42の端面に、シール材48が張付けられており、回転仕切板44の間、及び回転仕切板44との間の隙間をシールするようになっている。このシール材48は、例えば摩擦の少ない鉛黄銅、グラファイト、等であり、リークを低減しかつ動きを滑らかにしている。

## [0028]

図 5 は図 2 の C - C 線における断面図である。この図において、(A)は C - C 線における断面図、すなわち回転仕切板 4 4 の正面図であり、(B)は回転仕切板 4 4 を除去した断面図、すなわち固定仕切板 4 2 の正面図である。

## [0029]

固定仕切板 4 2 は、ほぼ全面を貫通する開口 4 2 a を有する。すなわち、この例では、支持フレーム 4 3 b と同位置で半径方向に延びる細長い放射部 4 2 b と、最外周、中央部、及び中間部の細いリング状の円形部 4 2 c とからなる。なお、この図で中央の円形部 4 2 c には、上述した軸受箱 4 3 が取付られている。なお、開口 4 2 a の位置はこの例に限定されず、可能な範囲で広く設定するのがよい。

## [0030]

回転仕切板44は、ガス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する吸

引開口44aと吐出開口44bを有する。

図5の第1実施形態において、冷却室22は、その内側を上下方向に通過するガス流路を有し、冷却室内22をガスが下方に流れるときに、吸引開口44aが冷却室の下方のみと連通しかつ吐出開口44bが冷却室の上方のみと連通し、冷却室44内をガスが上方に流れるときに、吸引開口44aが冷却室の上方のみと連通しかつ吐出開口44bが冷却室の下方のみと連通するように開口位置が設定されている。

なお、この例において、吸引開口 44a はほぼ 1/2 の円形、吐出開口 44b はほぼ 1/2 の扇形であり、互いに水平軸(前述の水平仕切板 22c)に対して反対側に設けられている。

#### [0031]

この構成により、冷却室 2 2 とガス冷却循環装置 2 4 との間を仕切る炉体内面積 A のうち、1/2 づつをガス冷却循環装置の吸込口と吐出口とし、更に吸込口と吐出口のうち、1/2 づつを下方、上方とすることで、吸引開口 4 4 a と吐出開口 4 4 b を炉体内面積 A の約 1/4 づつに設定することができる。従って、風路面積を大きくとれ、ガスの通過流速を低減でき、圧損を小さくできる。

また、固定仕切板42とガス冷却循環装置24の間は、内側全面がガス冷却循環装置の吸込口に連通し、外側全面だガス冷却循環装置の吐出口に連通しているので、吐出口/吸込み口の隙間を十分取ることで半面しか開口していなくても反対面への回り込みが可能となり、熱交換器全体を有効利用できる。

## [0032]

上述した本発明の構成によれば、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固定仕切板の表面に沿って回転仕切板を回転駆動するだけで、冷却室内を通過するガスの方向を交互に切り替えるので、流れ方向に対して回転仕切板が垂直に動く回転駆動であるため、高圧ガス(密度が高いガス体)であっても風圧の影響を受けにくくスムースに風路を切替えることができる。

また、回転仕切板が、ガス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する 吸引開口と吐出開口を有するので、開口面積の変動や吸込口と吐出口の開口面積 差が生じにくく、安定したガス冷却が可能である。また、構造が簡潔であり単一 の駆動装置で切替えが可能であり、大きな開口面積を確保できる。

なお、これまでは上下流のガス流れについて実施形態を示したが、回転仕切板を90°回転させて冷却室の整流器を側面(左右)に付けることで、左右流の切替え機構とすることもできる。

#### [0033]

図6は、本発明の第2実施形態を示す図5と同様の断面図である。この図において、(A)はC-C線における断面図、すなわち回転仕切板44の正面図であり、(B)は回転仕切板44を除去した断面図、すなわち固定仕切板42の正面図である。

この第2実施形態は、冷却室内をガスを上下方向に流すとき(上下流)と、冷却室内をガスを水平方向に流すとき(水平流)の両方に対応できるようになっている。

すなわち、この例において、吸引開口44aはほぼ1/4の円形、吐出開口4 4bはほぼ1/4の扇形であり、互いに水平軸(前述の水平仕切板22c)に対 して反対側に設けられている。

## [0034]

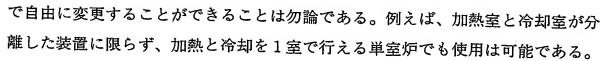
この第2実施形態では、冷却室22内をガスが上下方向に流れるときには、図5と同様に、吸引開口44aが冷却室22の下方のみ又は上方のみと選択的に連通し、かつ吐出開口44bが冷却室の上方のみ又は下方のみと選択的に連通するようになっている。また、図6(A)に示すように、冷却室22内をガスが水平方向に流れるときには、吸引開口44aが冷却室のいずれかの片側のみに選択的に連通し、かつ吐出開口44bが冷却室の反対の片側のみと選択的に連通するように開口位置が設定されている。

## [0035]

この構成により、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固定仕切板の表面 に沿って回転仕切板を回転駆動するだけで、冷却室内を通過するガスの方向を上 下方向及び左右方向に自由に切り替えることができる。

## [0036]

なお、本発明は上述した実施例に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない限り



#### [0037]

#### 【発明の効果】

上述したように、本発明の真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置は、風圧の影響を受けにくくスムースに風路を切替えることができ、開口面積の変動や吸込口と吐出口の開口面積差が生じにくく、安定したガス冷却が可能であり、構造が簡潔であり単一の駆動装置で切替えが可能であり、大きな開口面積を確保できる、等の優れた効果を有する。

## 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の第1実施形態の冷却ガス風路切替え装置を備えた真空熱処理炉の全体 構成図である。

#### 【図2】

図1の部分拡大図である。

#### 【図3】

図2のA-A線における断面図である。

#### 【図4】

図2のB部拡大図である。

#### 図5

図2のC-C線における断面図である。

#### 【図6】

本発明の第2実施形態を示す図5と同様の断面図である。

#### 【図7】

非特許文献1に開示された高速循環ガス冷却炉の構成図である。

#### 【図8】

特許文献1の「真空炉におけるガス循環冷却促進法」の構成図である。

#### 【符号の説明】

1 被処理品、2 循環ガス、

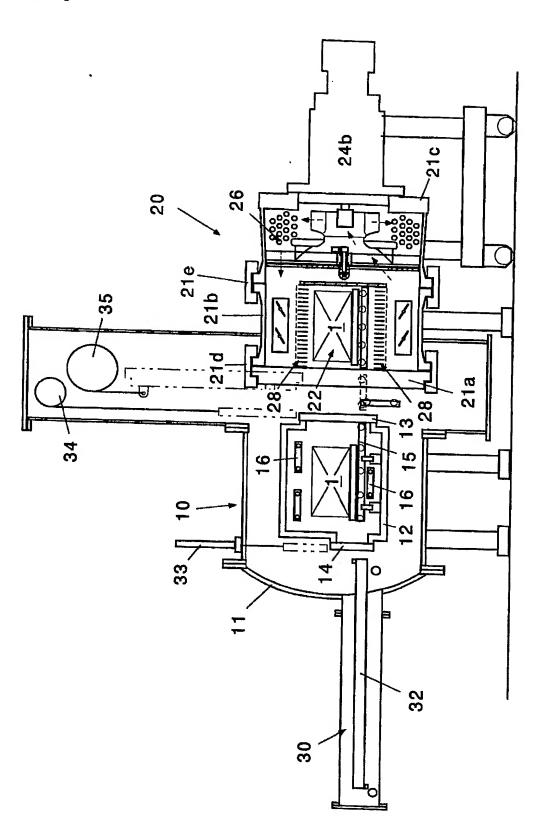
- 10 真空加熱炉、11 真空容器、12 加熱室、
- 13 前扉、14 後扉、15 載置台、16 ヒータ、
- 20 ガス冷却炉、21 真空容器、
- 21a 中間断熱扉、21b 容器胴部、
- 21c 循環部、21e クラッチリング、21d クランプ
- 22 冷却室、22a, 22b 断熱壁、22c 水平仕切板、
- 24 ガス冷却循環装置、24a 冷却ファン、
- 24b 冷却ファンモータ、25 熱交換器、
- 28 整流器、29 補助分配機構、30 移動装置、32 搬送棒、
- 33 後扉昇降装置、34 前扉昇降装置、
- 34 中間扉昇降装置、
- 40 冷却ガス風路切替え装置、
- 42 固定仕切板、42a 開口、
- 43 軸受箱、43a 軸受、43b 支持フレーム、
- 4.4 回転仕切板、4.4 a 吸引開口、4.4 b 吐出開口、
- 45 回転軸、46 回転駆動装置 (ラックとピニオン)、
- 47 圧縮バネ、48 シール材



【書類名】

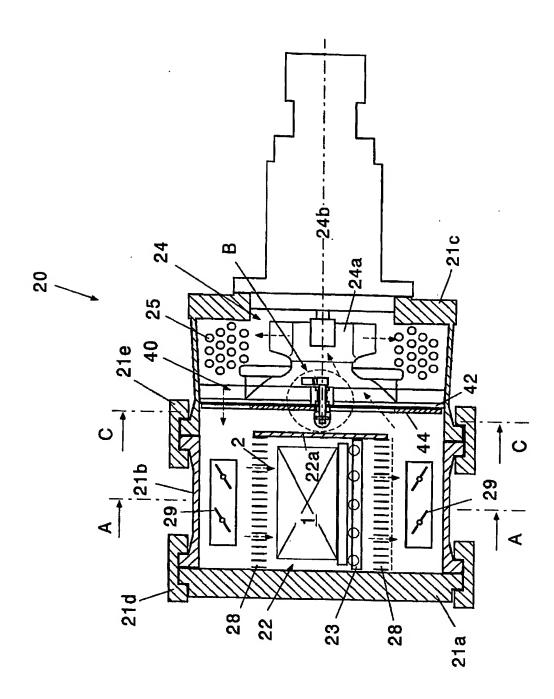
図面

【図1】



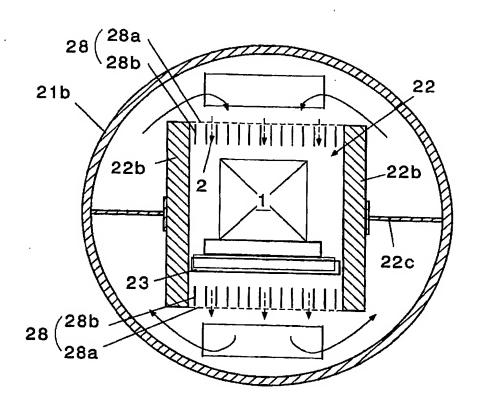


【図2】



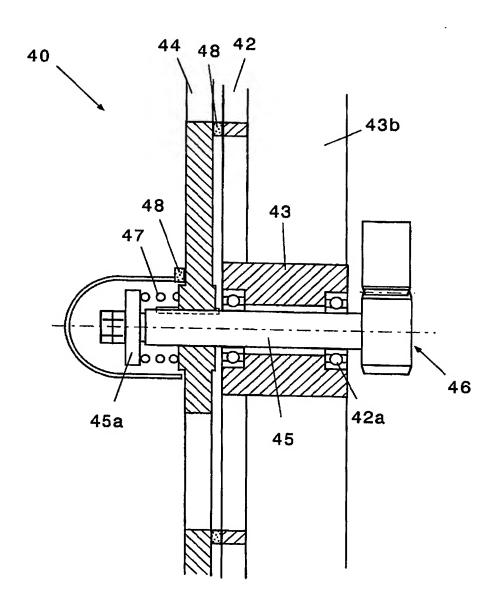


【図3】





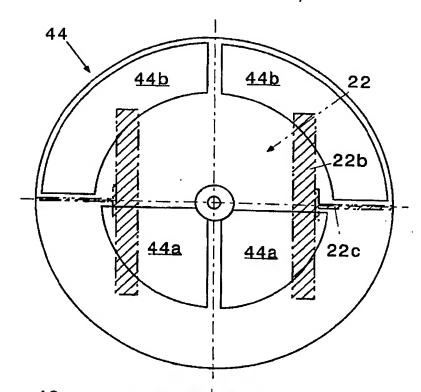
【図4】



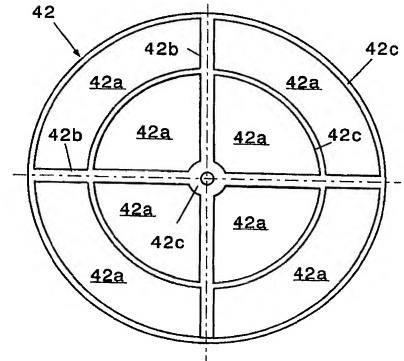


【図5】

(A)

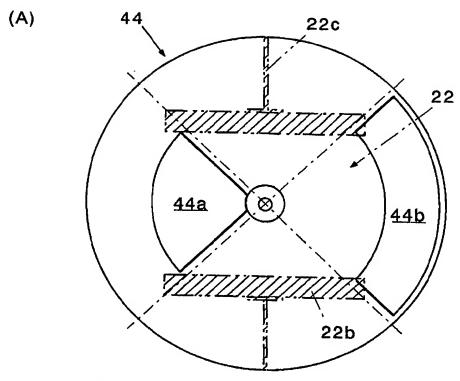


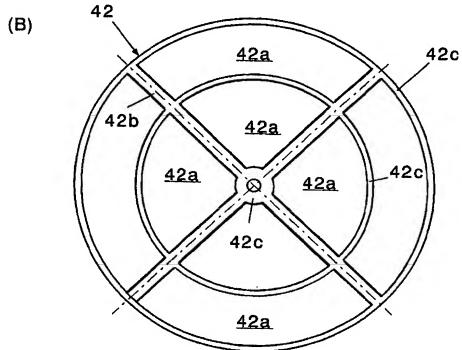
(B)





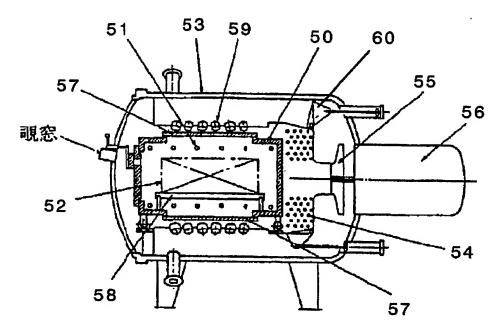
【図6】



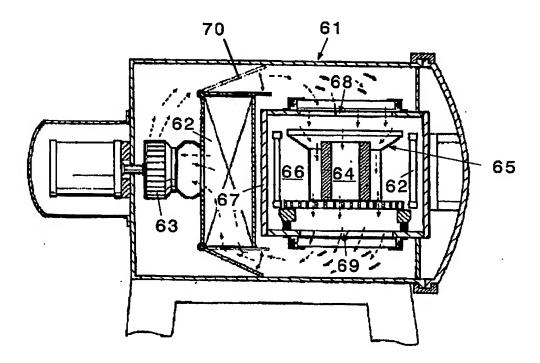




## 【図7】



【図8】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 風圧の影響を受けにくくスムースに風路を切替えることができ、開口面積の変動や吸込口と吐出口の開口面積差が生じにくく、安定したガス冷却が可能であり、構造が簡潔であり単一の駆動装置で切替えが可能であり、大きな開口面積を確保できる真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置を提供する。

【解決手段】 被処理品1を静置する冷却領域を囲む冷却室22と、該冷却室内を通過するガスを冷却して循環させるガス冷却循環装置24とを備え、加熱した被処理品を加圧した循環ガスで冷却する真空熱処理炉の冷却ガス風路切替え装置。 冷却室22とガス冷却循環装置24との間を仕切る固定仕切板42と、該固定仕切板の表面に沿って回転駆動される回転仕切板44とを有する。固定仕切板42はほぼ全面を貫通する開口42aを有し、回転仕切板44は、ガス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する吸引開口44aと吐出開口44bを有し、これにより冷却室内を通過するガスの方向を交互に切り替える。

【選択図】 図4



特願2003-183968

出願人履歴情報

識別番号

[00000099]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

1990年 8月 7日

由] 新規登録

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

石川島播磨重工業株式会社